

“半导体制造过程中产生的含过氧化氢的废水”

在半导体及液晶面板工厂综合废水处理设施中的使用实例

槽 原水槽 反应槽 凝集槽 沉淀槽 曝气槽

过氧化氢浓度 以下

停留时间 15 分钟

Asc Super 具有极强的耐酸碱性能，即使在高浓度过氧化氢下活性也几乎不会下降，因此最适合处理半导体工厂中基板清洗、蚀刻等工序中排出的含过氧化氢的废水。

定量添加 Asc Super

原水

调节剂 pH

生物处理工序

凝集剂